

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

25.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年11月28日

出願番号
Application Number: 特願2003-398774

[ST. 10/C]: [JP2003-398774]

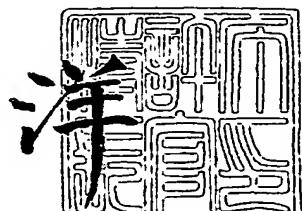
出願人
Applicant(s): 伊藤 耕三



2005年 1月13日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 CAP03010
【提出日】 平成15年11月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08G 65/48
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都荒川区荒川3丁目21番2号708
 【氏名】 伊藤 耕三
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都豊島区南長崎4-39-9 グレースマツミ110号室
 【氏名】 荒木 潤
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都文京区千駄木5-26-10 クレインズテラス304号
 【氏名】 趙 長明
【特許出願人】
 【識別番号】 500199826
 【住所又は居所】 東京都荒川区荒川3丁目21番2号708
 【氏名又は名称】 伊藤 耕三
【代理人】
 【識別番号】 100103447
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 井波 実
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 112738
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

ポリエチレンゲリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレンゲリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレンゲリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；及びカルボキシル基と反応する基を有する封鎖基と前記擬ポリロタキサンとを反応させて両末端に封鎖基を有するポリロタキサンを得る封鎖工程；を有するポリロタキサンの製造方法。

【請求項2】

ポリエチレンゲリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレンゲリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレンゲリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；及び前記擬ポリロタキサンと $-NH_2$ 基又は $-OH$ 基を有する封鎖基とを反応させて、 $-CO-NH-$ 封鎖基又は $-CO-O-$ 封鎖基の両末端を有するポリロタキサンを得る封鎖工程；を有するポリロタキサンの製造方法。

【請求項3】

前記カルボキシル化ポリエチレンゲリコールは、ポリエチレンゲリコールを2,2,6,6-テトラメチル-1-ペペリジニルオキシラジカル（TEMPO）により酸化して得られる請求項1又は2記載の方法。

【請求項4】

複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレンゲリコールが串刺し状に包接され、該カルボキシル化ポリエチレンゲリコールの両末端に前記複数のシクロデキストリン分子が遊離しないように封鎖する封鎖基を有するポリロタキサンであって、前記両末端は、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基とカルボキシル基とが反応して得られる構造を有する、上記ポリロタキサン。

【請求項5】

複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレンゲリコールが串刺し状に包接され、該カルボキシル化ポリエチレンゲリコールの両末端に前記複数のシクロデキストリン分子が遊離しないように封鎖する封鎖基を有するポリロタキサンであって、前記両末端の封鎖基が $-CO-NH-B_1$ 基又は $-CO-O-B_1$ 基の構造を有する、上記ポリロタキサン。

【請求項6】

2,2,6,6-テトラメチル-1-ペペリジニルオキシラジカル（TEMPO）によりポリエチレンゲリコールを酸化してポリエチレンゲリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレンゲリコールを得るカルボキシル化工程；及び前記カルボキシル化ポリエチレンゲリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、シクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレンゲリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；を有する擬ポリロタキサンの製造方法。

【請求項7】

シクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレンゲリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンであって、前記カルボキシル化ポリエチレンゲリコールの両末端は $COOH$ 基である擬ポリロタキサン。

【請求項8】

2,2,6,6-テトラメチル-1-ペペリジニルオキシラジカル（TEMPO）によりポリエチレンゲリコールを酸化してポリエチレンゲリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレンゲリコールを得る、カルボキシル化ポリエチレンゲリコールの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】ポリロタキサン及びその製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、ポリロタキサン及びその製造方法に関し、特に両末端に—CO—NH—封鎖基又は—CO—O—封鎖基などのカルボキシル基と反応する基を有する封鎖基とカルボキシル基とが反応して得られる構造を有するポリロタキサン及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

ポリロタキサンは、環状分子（回転子：rotator）の開口部が直鎖状分子（軸：axis）によって串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンの両末端（直鎖状分子の両末端）に、環状分子が遊離しないように封鎖基を配置して成る。例えば、環状分子として α -シクロデキストリン（以降、シクロデキストリンを単に「CD」と略記する場合がある）、直鎖状分子としてポリエチレングリコール（以降、「PEG」と略記する場合がある）を用いたポリロタキサンは、種々の特性を有することから、その研究が近年、盛んに行われている。

【0003】

ポリロタキサンの調製法は一般に、PEGの両末端である—OH基を—NH₂基に置換して、両末端が—NH₂基であるH₂N—PEG—NH₂を得た後、該H₂N—PEG—NH₂と α -CDとを混合して α -CDが包接された擬ポリロタキサンを得、その後、該擬ポリロタキサンと—COOH基を有する封鎖基（B1—COOH）、例えばアダマンタン酢酸とを反応させて擬ポリロタキサンのPEG部位の両末端が—NH—CO—O—B1基で封鎖されたポリロタキサンを得ていた（特許文献1を参照のこと）。

【0004】

一般に、—NH₂基と—COOH基とのアミド化反応は、カルボキシル基を活性化して正電荷を帯びたカルボニル炭素にアミンの非共有電子対が求核的に攻撃して行う反応が多く用いられている。この場合、活性化カルボニルに対して大過剰のアミンを添加する場合が多い（非特許文献1を参照のこと）。

【0005】

また、両末端が—NH₂基であるH₂N—PEG—NH₂は市販されているものの、PEGの分子量に関してその種類が乏しく、特にPEGの分子量が大であるものが乏しい。そのため、PEGの両末端—OH基をN,N'-カルボニルジイミダゾール及びエチレンジアミンで修飾して、種々のPEG分子量、特にPEG分子量が大であるH₂N—PEG—NH₂を調製していた（特許文献1及び非特許文献2を参照のこと）。これを、上述と同様の方法によりポリロタキサンへとさらに調製することにより、種々の分子量を有するポリロタキサンを得ていた。

【特許文献1】WO 01/83566号公報。

【非特許文献1】P. Builpitt, D. Aeschlimann, J. Biomed. Mater. Res., 47 (1999), 152-169。

【非特許文献2】H. Fujita, T. Ooya, N. Yui, Macromolecules 32 (1999), 2534-2541。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、上記のアミド化反応、即ち、CDが包接されたH₂N—PEG—NH₂と—COOH基を有する封鎖基との反応において、大過剰のアミンを用いること、即ちH₂N—PEG—NH₂を大過剰で用いることは、収率上及びコスト上、好ましくない。また、反応を効率よく行うために、大過剰のカルボキシル基、即ち—COOH基を有する封鎖基を大過剰に用いる方策を探ることもできるが、この場合、活性化試薬、例えばBOP試薬（ベンゾトリシアゾール-1-イル-オキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウム・ヘ

キサフルオロフォスフェート) 及び/又は HOBt 試薬 (1-ヒドロキシ-1H-ベンゾトリアゾール・モノヒドレート) が大量に必要となり、コスト上、好ましくない。

【0007】

また、両末端が $-NH_2$ 基である $H_2N-PEG-NH_2$ を用いる場合、封鎖基はアミンと反応する物質、例えば $-COOH$ 基を有するものに限定される。したがって、封鎖基の選択性が限定されるか又は所望の封鎖基を得るためにさらにコストがかかる虞がある。

さらに、特許文献1及び非特許文献2の方法により、種々の分子量を有し、且つ両末端に $-NH_2$ 基を有する $H_2N-PEG-NH_2$ を得ることができるが、その末端は詳細には $-O-(CH_2)_2-O-CO-NH-(CH_2)_2-NH_2$ であった。このため、PEG 部位と封鎖基との間に、ウレタン結合又はカルバメート結合 ($-O-CO-NH-$) とアミド結合とが存在するため、化学的に不安定になる虞があった。

【0008】

そこで、本発明の目的は、従来技術が有していた問題点を解決することにある。

具体的には、本発明の目的は、擬ポリロタキサンを大過剰で用いることなく、及び/又は活性化試薬を大過剰に用いることなく、収率良く且つコスト上も好ましいポリロタキサンの製造方法を提供することにある。

【0009】

また、上記目的に加えて、又は上記目的の他に、本発明の目的は、従来技術が有していた問題点、即ち封鎖基の種類に関して、より選択性の幅を広げ、所望の封鎖基を有するポリロタキサン及びその製造方法を提供することにある。

さらに、上記目的に加えて、又は上記目的の他に、本発明の目的は、種々のPEG分子量を有し且つ化学的に安定な結合を有するポリロタキサン及びその製造方法を提供することにある。

【0010】

具体的には、本発明の目的は、従来、封鎖基側の $-COOH$ 基とPEG側の $-NH_2$ 基との反応により得ていたポリロタキサンに替えて、PEG側を $-COOH$ 基とし且つ封鎖基側を該 $-COOH$ と反応する基、例えば $-NH_2$ 基又は $-OH$ 基とし、これらの反応により、例えば $-CO-NH-B1$ 末端又は $-CO-O-B1$ 末端などのPEG側の $-COOH$ 基と該 $-COOH$ と反応する基とが反応した結果得られる構造を有するポリロタキサン、及びその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明者らは、以下の発明により、上記課題を解決できることを見出した。

<1> ポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；及びカルボキシル基と反応する基を有する封鎖基と前記擬ポリロタキサンとを反応させて両末端に封鎖基を有するポリロタキサンを得る封鎖工程；を有するポリロタキサンの製造方法。

<2> 上記<1>において、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基が $-NH_2$ 基を有する封鎖基又は $-OH$ 基を有する封鎖基であり、ポリロタキサンの両末端はそれぞれ、 $-CO-NH-$ 封鎖基又は $-CO-O-$ 封鎖基の構造を有するのがよい。

【0012】

<3> ポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；及び擬ポリロタキサンと $-NH_2$ 基又は $-OH$ 基を有する封鎖基とを反応させて、 $-CO-NH-$ 封鎖基又は $-CO-O-$ 封鎖基の両末端を有するポリロタキサンを得る封鎖工程；を有するポリロタキサンの製造方法。

<4> 上記<1>～<3>のいずれかにおいて、カルボキシル化ポリエチレングリコ

ールは、ポリエチレングリコールを2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル（TEMPO）により酸化して得られるのがよい。

【0013】

＜5＞ 複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接され、該カルボキシル化ポリエチレングリコールの両末端に前記複数のシクロデキストリン分子が遊離しないように封鎖する封鎖基を有するポリロタキサンであって、前記両末端は、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基とカルボキシル基とが反応して得られる構造を有する、上記ポリロタキサン。

＜6＞ 上記＜5＞において、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基が-NH₂基を有する封鎖基又は-OH基を有する封鎖基であり、それによって得られる構造がそれぞれ、-CO-NH-封鎖基又は-CO-O-封鎖基で表されるのがよい。

【0014】

＜7＞ 複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接され、該カルボキシル化ポリエチレングリコールの両末端に複数のシクロデキストリン分子が遊離しないように封鎖する封鎖基を有するポリロタキサンであって、両末端の封鎖基が-CO-NH-B1基又は-CO-O-B1基の構造を有する、上記ポリロタキサン。

【0015】

＜8＞ 2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル（TEMPO）によりポリエチレングリコールを酸化してポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールを得るカルボキシル化工程；及びカルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、シクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；を有する擬ポリロタキサンの製造方法。

【0016】

＜9＞ シクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンであって、カルボキシル化ポリエチレングリコールの両末端はCOOH基である擬ポリロタキサン。

＜10＞ 2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル（TEMPO）によりポリエチレングリコールを酸化してポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールを得る、カルボキシル化ポリエチレングリコールの製造方法。

【発明の効果】

【0017】

本発明により、擬ポリロタキサンを大過剰で用いることなく、及び／又は活性化試薬を大過剰に用いることなく、収率良く且つコスト上も好ましいポリロタキサンの製造方法を提供することができる。

【0018】

また、上記効果に加えて、又は上記効果の他に、本発明により、封鎖基の種類について、より選択性の幅を広げ、所望の封鎖基を有するポリロタキサン及びその製造方法を提供することができる。

さらに、上記効果に加えて、又は上記効果の他に、本発明により、種々のPEG分子量を有し且つ化学的に安定な結合を有するポリロタキサン及びその製造方法を提供することができる。

【0019】

具体的には、本発明により、従来、封鎖基側の-COOH基とPEG側の-NH₂基との反応により得ていたポリロタキサンに替えて、PEG側を-COOH基とし且つ封鎖基側を該-COOHと反応する基、例えは-NH₂基又は-OH基とし、これらの反応により、例えは-CO-NH-B1末端又は-CO-O-B1末端などのPEG側の-COOH基と該-COOHと反応する基とが反応した結果得られる構造を有するポリロタキサン

、及びその製造方法を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明は、ポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；及びカルボキシル基と反応する基を有する封鎖基と前記擬ポリロタキサンとを反応させて、両末端に封鎖基、例えば-CO-NH-封鎖基又は-CO-O-封鎖基で表される封鎖基を有するポリロタキサンを得る封鎖工程；を有するポリロタキサンの製造方法を提供する。なお、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基は、-NH₂基を有する封鎖基又は-OH基を有する封鎖基であるのがよく、それぞれを用いることにより-CO-NH-封鎖基を有するポリロタキサン又は-CO-O-封鎖基を有するポリロタキサンを得るのがよい。

【0021】

本発明のポリロタキサンの製法は、まず、ポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程に付される。

本発明に用いられるポリエチレングリコール(PEG)は、その分子量が限定されず、高分子量のものであってもよい。

【0022】

カルボキシル化PEG、即ちその両末端がカルボキシル化(-COOH)されているPEGは、従来より公知の方法により得られたもの、例えば過マンガン酸カリウムによる酸化、酸化マンガン/過酸化水素による酸化などによって得られたもの、無水コハク酸付加法によって得られたもの、又はプロモ酢酸エチルを付加した後にアルカリ加水分解するいわゆるカルボキシメチル化法によって得られたものなどを用いてもよい。

特に、カルボキシル化PEGは、PEGを2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル(TEMPO)により酸化して得られるものを用いるのが好ましい。

【0023】

TEMPOを用いる酸化は、水に臭化ナトリウム及び次亜塩素酸ナトリウムを共存させた弱塩基性下の系、又は水-有機溶媒(例えば塩化メチレン、クロロホルム、アセトニトリルなど)の2相系もしくは混合系溶媒に炭酸水素ナトリウム又は臭化カリウムなどを共存させた系で行うことができる。また、圧力：大気圧下、温度：0℃～室温などの条件で行うことができる。特に好ましいTEMPO酸化の条件は、水に臭化ナトリウム及び次亜塩素酸ナトリウムを共存させ、pHを10～11に保持しながら、0℃～室温、大気圧下で行うのがよい。

【0024】

TEMPOを用いる酸化は、従来のカルボキシル化PEGの製法と異なり、1つの工程でカルボキシル化が行える点、修飾率が向上する点で好ましい。

【0025】

カルボキシル化PEGと混合するシクロデキストリン(CD)は、各種のCDを用いることができる。例えば、 α -CD、 β -CD、 γ -CDなどを挙げることができ、 α -CDであるのが好ましい。

【0026】

カルボキシル化PEGとCDとを混合する条件は、溶媒中に両者を添加し、温度：室温付近、圧力：大気圧、時間：数時間～一昼夜、放置する条件であるのがよい。用いる溶媒は、カルボキシル化PEG及びCDを溶解する溶媒であれば、特に限定されないが、水、DMSO、DMFなどを挙げることができる。

【0027】

包接工程によって得られた擬ポリロタキサンは、次いで、該擬ポリロタキサンと-NH₂基又は-OH基を有する封鎖基とを反応させて、-CO-NH-封鎖基又は-CO-O-封鎖基の両末端を有するポリロタキサンを得る封鎖工程に付される。

【0028】

封鎖基は、カルボキシル基と反応する基、例えば-NH₂基又は-OH基を有し、得られるポリロタキサンのCDが串刺し状の包接状態から解放されないようにCDを封鎖する基であれば、特に限定されない。カルボキシル基と反応する基としては、-NH₂基又は-OH基であるのが好ましいが、これに限定されない。例えば、封鎖基は、カルボキシル基と反応する基を有する次のものを挙げることができる。ジニトロフェニル基類、アダマンタン基類、アントラセン基類、トリチル基類、シクロデキストリン類、フルオレセイン類及びピレン類、並びにこれらの誘導体基を挙げることができるが、これに限定されない。

【0029】

封鎖工程の条件は、封鎖基が有するカルボキシル基と反応する基に依存して用いることができる。例えば、カルボキシル基と反応する基として-NH₂基又は-OH基を用いる場合、従来より公知のアミド化又はエステル化反応に用いられる条件を用いてもよい。なお、本発明において、アミド化反応を生じるカルボキシル基側が擬ポリロタキサンであり、アミノ基側が封鎖基である場合、擬ポリロタキサンを大過剰に用いる必要がないため、好ましい。また、一般的のアミド化反応に用いられる活性化試薬、例えばBOP試薬及び/又はHOBt試薬についても大過剰に用いる必要がないため、好ましい。

【0030】

上記の方法により、本発明は、複数のシクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接され、該カルボキシル化ポリエチレングリコールの両末端に複数のシクロデキストリン分子が遊離しないように封鎖する封鎖基を有するポリロタキサンであって、前記両末端は、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基とカルボキシル基とが反応して得られる構造を有するポリロタキサンを提供することができる。なお、カルボキシル基と反応する基を有する封鎖基として-NH₂基を有する封鎖基又は-OH基を有する封鎖基を用いるのがよく、この場合、得られるポリロタキサンの両末端が-CO-NH-B1基又は-CO-O-B1基の構造を有することができる。

ここで、シクロデキストリン分子、カルボキシル化PEG、及び封鎖基は、上述した通りである。また、「-CO-NH-B1基」又は「-CO-O-B1基」の「B1」は、-NH₂基又は-OH基を有する封鎖基の-NH₂基又は-OH基以外の部位を意味する。

【0031】

また、本発明は、ポリロタキサンの中間体である擬ポリロタキサン、及びその製造方法も提供する。

即ち、本発明の擬ポリロタキサンは、シクロデキストリン分子の開口部にカルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンであって、カルボキシル化ポリエチレングリコールの両末端がCOOH基であることに特徴を有する。

【0032】

また、本発明の擬ポリロタキサンの製造方法は、カルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、シクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接されてなる擬ポリロタキサンを得る包接工程；を有する。特に、本発明の擬ポリロタキサンの製造方法は、カルボキシル化ポリエチレングリコールが2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル(TEMPO)によりポリエチレングリコールを酸化することにより、ポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールを得るのがよい。

【0033】

さらに、本発明は、ポリロタキサンの中間体、擬ポリロタキサン、の主要部位である、カルボキシル化ポリエチレングリコールの製造方法をも提供する。即ち、本発明のカルボ

キシリ化ポリエチレングリコールの製造方法は、2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル（TEMPO）によりポリエチレングリコールを酸化してポリエチレングリコールの両末端がカルボキシリ化されたカルボキシリ化ポリエチレングリコールを得る。なお、この製法の条件等については、上述した通りである。

【0034】

以下、実施例に基づいて、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は本実施例に限定されるものではない。

【実施例1】

【0035】

<PEGのTEMPO酸化によるPEGカルボン酸の調製>

PEG（分子量2万または3.5万）10g、TEMPO（2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル）100mg、及び臭化ナトリウム1gを水100mlに溶解した。得られた溶液に市販の次亜塩素酸ナトリウム水溶液（有効塩素濃度約5%）5mlを添加し、室温で攪拌しながら反応させた。反応が進行すると添加直後から系のpHは急激に減少するが、なるべくpH：10～11を保つように1N NaOHを添加して調製した。pHの低下は概ね3分以内に見られなくなったが、さらに10分間攪拌した。エタノールを最大5mlまでの範囲で添加して反応を終了させた。塩化メチレン50mlでの抽出を3回繰り返して無機塩以外の成分を抽出した後、エバポレータで塩化メチレンを除去した。温エタノール250mlに溶解させた後、-4℃の冷凍庫に一晩おいてPEGカルボン酸のみを析出させた。析出したPEGカルボン酸を遠心分離で回収した。この温エタノール溶解ー析出ー遠心分離のサイクルを数回繰り返し、最後に真空乾燥で乾燥させてPEGカルボン酸を得た。収率95%以上。カルボキシリ化率95%以上。

【0036】

<PEGカルボン酸とα-CDとを用いた包接錯体の調製>

上記で調製したPEGカルボン酸3g及びα-CD12gをそれぞれ別々に用意した70℃の温水50mlに溶解させた後、両者を混合し、その後、冷蔵庫（4℃）中で一晩静置した。クリーム状に析出した包接錯体を凍結乾燥し回収した。収率90%以上（収量約14g）。

【0037】

<アダマンタンアミンとBOP試薬反応系を用いた包接錯体の封鎖>

室温でジメチルホルムアミド（DMF）50mlにアダマンタンアミン0.13gを溶解し、上記で得られた包接錯体14gに添加した後、すみやかによく振りませた。続いて、BOP試薬（ベンゾトリアゾール-1-イル-オキシ-トリス（ジメチルアミノ）ホスホニウム・ヘキサフルオロfosfato）0.38gをDMF25mlに溶解したものを添加し、同様によく振りませた。さらに、ジイソプロピルエチルアミン0.14mlをDMF25mlに溶解したものを添加し、同様によく振り混ぜた。得られた混合物を冷蔵庫中で一晩静置した。その後、DMF/メタノール=1:1混合溶液100mlを加えてよく混ぜ、遠心分離して上澄みを捨てた。このDMF/メタノール混合溶液による洗浄を2回繰り返した後、さらにメタノール100mlを用いた洗浄を同様の遠心分離により2回繰り返した。得られた沈澱を真空乾燥した後、ジメチルスルホキシド（DMSO）50mlに溶解し、得られた透明な溶液を水700ml中に滴下してポリロタキサンを析出させた。析出したポリロタキサンを遠心分離で回収し、真空乾燥又は凍結乾燥させた。このDMSO溶解ー水中で析出ー回収ー乾燥のサイクルを2回繰り返し、最終的に精製ポリロタキサンを得た。添加した包接錯体をベースにした収率約68%（包接錯体14gからの収量は、分子量3.5万のPEGの場合9.6g）であった。

【実施例2】

【0038】

<シクロデキストリンとBOP試薬反応系を用いた包接錯体の封鎖>

室温でDMF50mlに、BOP試薬3g、HOBt1g、シクロデキストリン3.0g、ジイソプロピルエチルアミン1.25mlをこの順番で溶解させた。これに、実施例

1で得られた包接錯体14gを添加した後、速やかによく振り混ぜた。スラリー状になつた試料を冷蔵庫中で一晩静置した。その後、DMF／メタノール=1:1混合溶液50m1を加えてよく混ぜ、遠心分離して上澄みを捨てた。このDMF／メタノール混合溶液による洗浄を2回繰り返した後、さらにメタノール100m1を用いた洗浄を同様の遠心分離により2回繰り返した。得られた沈殿を真空乾燥した後、DMSO50m1に溶解し、得られた透明な溶液を水700m1中に滴下してポリロタキサンを析出させた。析出したポリロタキサンを遠心分離で回収し、真空乾燥又は凍結乾燥させた。このDMSO溶解一水中で析出一回収一乾燥のサイクルを2回繰り返し、最終的に精製ポリロタキサンを得た。添加した包接錯体をベースにした収率約57%（包接錯体14gからの収量は、分子量3.5万のPEGの場合8.0g）であった。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 摘ポリロタキサンを大過剰で用いることなく、及び／又は活性化試薬を大過剰に用いることなく、収率良く且つコスト上も好ましいポリロタキサンの製造方法の提供。

【解決手段】 ポリエチレングリコールの両末端がカルボキシル化されたカルボキシル化ポリエチレングリコールとシクロデキストリン分子とを混合して、複数のシクロデキストリン分子の開口部に前記カルボキシル化ポリエチレングリコールが串刺し状に包接される摘ポリロタキサンを得る包接工程；及び摘ポリロタキサンと-NH₂基又は-OH基を有する封鎖基とを反応させて、-CO-NH-封鎖基又は-CO-O-封鎖基の両末端を有するポリロタキサンを得る封鎖工程；を有するポリロタキサンの製造方法により、上記課題を解決する。

【選択図】 なし

特願 2003-398774

出願人履歴情報

識別番号

[500199826]

1. 変更年月日

[変更理由]

2000年 4月28日

新規登録

住所 東京都荒川区荒川3丁目21番2号708

氏名 伊藤 耕三

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017402

International filing date: 24 November 2004 (24.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-398774
Filing date: 28 November 2003 (28.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse